PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-113868

(43)Date of publication of application: 16.04.2002

(51)Int.Cl.

B41J 2/05

(21)Application number: 2001-236250

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

03.08.2001

(72)Inventor: SUGIOKA HIDEYUKI

(30)Priority

Priority number: 2000236889

Priority date: 04.08.2000

Priority country: JP

(54) INK JET RECORDING HEAD AND INK JET RECORDER

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a nonlinear element itself from being broken by heating of the nonlinear element.

SOLUTION: A plurality of striped lower electrodes 5 where an insulating thin film 24 is set, and a plurality of information electrodes 7 are formed on a substrate 23 having a lower layer (thin film oxidation insulating layer) 22, on which a plurality of striped upper electrodes 6 are formed, and moreover a resistance heating unit 2 is formed. The lower electrodes 5 and the information electrodes 7 constitute a matrix circuit, and at the same time the lower electrodes 5, the upper electrodes 6 and the insulating thin film 24 constitute an MIM element 1. The resistance heating unit 2 is connected in series to the MIM element 1. The MIM element 1 is turned on when a voltage is impressed between the lower electrodes 5 and the information electrodes 7, whereby an electricity is supplied to the resistance heating unit 2 to make the unit heat. Liquid drops 9 are accordingly

discharged from a discharge opening 8. An area of the MIM element 1 is made larger than an area of the resistance heating unit 2.

(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-113868 (P2002-113868A)

(43)公開日 平成14年4月16日(2002.4.16)

(51) Int.Cl.7

識別記号

 \mathbf{F} I

テーマコート*(参考)

B41J 2/05

B41J 3/04 103B 2C057

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願2001-236250(P2001-236250)

(22)出願日

平成13年8月3日(2001.8.3)

(31)優先権主張番号 特願2000-236889(P2000-236889)

(32)優先日

平成12年8月4日(2000.8.4)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 杉岡 秀行

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 100088328

弁理士 金田 暢之 (外2名)

Fターム(参考) 20057 AF37 AF55 AG39 AG46 AP52

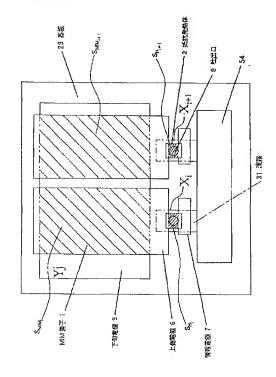
AP56 AR05 BA03 BA13

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録ヘッドおよびインクジェット記録装置

(57) 【要約】

【課題】 非線形素子の発熱により非線形素子自体が破 壊されることを防止する。

【解決手段】 下部層(薄膜酸化絶縁層)22を有する 基板23上に、絶縁性薄膜24が設けられた複数のスト ライプ状の下側電極5と、複数の情報電極7が形成さ れ、その上に、複数のストライプ状の上側電極6が形成 され、さらに抵抗発熱体2が形成されている。下側電極 5および情報電極7からマトリクス回路が構成されると ともに、下側電極5と上側電極6と絶縁性薄膜24とに よってMIM素子1が構成されている。MIM素子1に は抵抗発熱体2が直列に接続されている。下側電極5と 情報電極7との間に電圧を印加すると、MIM素子1が オン状態となり、抵抗発熱体2に電力が供給されて発熱 し、液滴9が吐出口8より吐出する。MIM素子1の面 積は抵抗発熱体2の面積よりも大きい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクを吐出するために利用される熱エネルギーを発生する抵抗発熱体と、該抵抗発熱体に接続される一対の電極と、を有する発熱手段と、前記抵抗発熱体を駆動するために前記抵抗発熱体に直列接続され、極性に依らず、低い電圧を印加した時の抵抗値が、高い電圧を印加した時の抵抗値に比べて高い値を示すMIM型の電流電圧特性を有する非線形素子と、を有するインクジェット記録ヘッドであって、

該非線形素子の面積が、前記抵抗発熱体の、前記一対の 10 電極間の面積よりも大きいことを特徴とするインクジェット記録ヘッド。

【請求項2】 前記非線形素子の面積が、前記抵抗発熱体の、前記一対の電極間の面積の3.7倍~10⁸倍である、請求項1に記載のインクジェット記録ヘッド。

【請求項3】 駆動状態における前記非線形素子の抵抗値が、前記抵抗発熱体の抵抗値と実質的に等しい、請求項1または2に記載のインクジェット記録ヘッド。

【請求項4】 前記非線形素子の、吐出口配列方向の長さは、該配列方向と実質的に直交する方向の長さよりも 20 短い、請求項1~3のいずれか1項に記載のインクジェット記録ヘッド。

【請求項5】 前記非線形素子は前記抵抗発熱体と同一の基板上に形成されており、該基板と実質的に垂直な方向には前記抵抗発熱体に対応して形成された流路内のインクを吐出する吐出口が形成されており、前記流路は、前記抵抗発熱体が形成された位置から、主に前記非線形素子が配設されている位置と反対側に延びている、請求項1~4のいずれか1項に記載のインクジェット記録へッド。

【請求項6】 前記非線形素子が前記抵抗発熱体と同一の基板上に形成されており、該基板と実質的に平行な方向には前記抵抗発熱体に対応して形成された流路内のインクを吐出する吐出口が形成されており、前記流路は、前記抵抗発熱体が形成された位置から、主に前記非線形素子の配設されている位置側に延びている、請求項1~4のいずれか1項に記載のインクジェット記録へッド。 【請求項7】 前記非線形素子に対する冷却構造を有する、請求項1~6のいずれか1項に記載のインクジェット記録へッド。

【請求項8】 前記発熱手段に電圧を印加するためのマトリクス回路を構成するマトリクス電極を有する、請求項1~7のいずれか1項に記載のインクジェット記録へッド。

【請求項9】 前記非線形素子は、前記マトリクス電極の交点に配置されている、請求項8に記載のインクジェット記録ヘッド。

【請求項10】 前記熱エネルギーによりインクに膜沸騰を生起させてインクを吐出する、請求項1~9のいずれか1項に記載のインクジェット記録へッド。

【請求項11】 前記抵抗発熱体に対応して設けられ、被記録媒体の被記録面にインクを吐出する吐出口を有する、請求項1~10のいずれか1項に記載のインクジェット記録ヘッドと、被記録媒体を搬送する搬送手段と、を少なくとも具備することを特徴とするインクジェット記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェットプリンタに用いられる、特に発泡現象を利用したバブルジェット(登録商標) 記録方式のインクジェット記録へッドおよびインクジェット記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】バブルジェット記録方式のインクジェット記録へッドは、一般に、微細な吐出口と流路とこの流路の一部に設けられている発熱体とを備えている。バブルジェット記録方式とは、発熱体を用いて流路内の液体を局所的に高温にすることにより気泡を発生させ、発泡時の高い圧力を利用して、液体を微細な吐出口より押し出し、液滴を記録紙等に付着させる記録方式である。

【0003】このバブルジェット記録方式で記録される 画像を高精細化するためには、微小な液滴を高密度に吐 出させる技術が要求される。そのため、微細な流路と微 細な発熱体を形成することが特に重要である。それゆ え、バブルジェット記録方式の構造の単純性を活かし て、フォトリソグラフィ技術を駆使して高密度化可能な ヘッドの製造方法が提案されている(たとえば、特開平 08-15629号公報)。また、液滴の吐出量を調整 するために、端部に比べ中央部の発熱量が大きい発熱体 30 が提案されている(特開昭62-201254号公 報)

【0004】発熱体としては、通常、厚さ 0.05μ m程度の窒化タンタル薄膜抵抗体を用い、これに通電した時のジュール熱で液体の発泡を行う。このような抵抗発熱体には、通常、キャビテーションによる抵抗発熱体表面の損傷を防止するために、 0.8μ m程度のSiNなどの絶縁層を介して厚さ 0.2μ m程度のTaなどの金属からなる耐キャビテーション層が設けられている。

【0005】また、特開昭64-20150号公報に 40 は、基板上に複数の縦配線と複数の横配線が設けられ、 両者の交点部分に、順電流のみが流れる整流素子とこれ に接続された発熱素子とが設けられているマルチノズル インクジェットヘッドが開示されている。また、特開昭 57-36679号公報には、基板上に、順方向通電に より発熱可能な複数のダイオードがアレイ状に配列され ているサーマルヘッドが開示されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来のインクジェット 記録ヘッドの多くは、発熱素子とダイオードやロジック 50 回路部が、半導体プロセス(イオン注入などの方法)で 20

シリコン基板上に同時に作り込まれている。したがっ て、比較的ノズル数の少ないヘッドではコンパクト化で き、単一の工程で出来るという利点がある。しかし、例 えば紙幅いっぱいの長さを有するフルラインマルチへッ ドは12インチ(約30cm)程度の長さが必要で、こ れを一体形成しようとすると、通常のシリコンウェハー を使うことが難しく高コスト化を招くおそれがある。

【0007】そこで、イオン注入法などの従来の半導体 プロセスに頼らないで作成できる非線形素子を用いて、 マトリクス状に配列されたバブルジェット記録用の発熱 10 素子を選択的に駆動することができれば、長尺のインク ジェット記録ヘッドを低コストで提供できる可能性があ る。

【0008】従来から、非線形素子であるMIM素子等 が液晶装置などに用いられている。このMIM素子が液 晶装置に用いられる場合、通常の電力密度は1W/m² 程度である。これに対して、バブルジェット記録ヘッド の発熱体としてはおよそ $0.1 \, \text{GW/m}^2$ 以上の電力密 度を扱う必要がある。したがって、MIM素子をバブル ジェット記録ヘッドの発熱体として用いようとすると、 液晶装置に用いられる場合等と比べてはるかに大きな電 カを、MIM素子に直列接続した抵抗素子に供給する必 要があった。この問題に対して、MIM素子への印加電 圧を上げることにより、MIM素子へ供給可能な電力を 上げることはある程度可能である。しかしながら、MI M素子そのものの発熱によってM I M素子の温度が上昇 して素子自体の破壊に至るおそれがあった。このような MIM素子そのものの発熱は、液晶装置に用いられる場 合など、MIM素子をマトリクス駆動用の非線形素子と する従来の構成ではまったく問題とならなかったが、M 30 IM素子をバブルジェット記録装置の発熱体のマトリク ス駆動用の非線形素子として用いる場合には、その特有 の問題として、MIM素子の発熱によりMIM素子自体 が破壊されるおそれがある。

【0009】そこで本発明の目的は、バブルジェット記 録方式の発熱体を駆動するためにMIM型電気特性を有 する非線形素子を用い、その非線形素子の発熱により非 線形素子自体が破壊されることを防止し、低コストで長 尺化可能なインクジェット記録ヘッドおよびインクジェ ット記録装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の特徴は、インク を吐出するために利用される熱エネルギーを発生する抵 抗発熱体と、抵抗発熱体に接続される一対の電極とを有 する発熱手段と、抵抗発熱体を駆動するために抵抗発熱 体に直列接続され、極性によらず、低い電圧を印加した 時の抵抗値が、高い電圧を印加した時の抵抗値に比べて 高い値を示すMIM型の電流電圧特性を有する非線形素 子とを有し、非線形素子の面積が、抵抗発熱体の、一対 の電極間の面積よりも大きいところにある。この構成に 50 より、非線形素子の発熱により非線形素子自体が破壊し てしまうことが防げる。

【0011】さらに、非線形素子の面積が、抵抗発熱体 の、一対の電極間の面積の3. 7倍~108倍であるこ とが好ましい。これにより、非線形素子の発熱により非 線形素子自体が破壊してしまうことが防げるとともに、 ヘッドの小型化の妨げとならない。さらに、吐出用液体 の発泡に必要な大電流を流しつつ、素子駆動コストの上 昇を生じない程度に駆動電圧を低く抑えることができ る。

【〇〇12】また、非線形素子の、吐出口配列方向の長 さが、該配列方向と実質的に直交する方向の長さよりも 短いことが好ましい。これにより、吐出口と非線形素子 を高密度に並べることができる。

【0013】また、非線形素子が抵抗発熱体と同一の基 板上に形成されており、基板と実質的に垂直な方向に形 成された吐出口を有し、流路が、抵抗発熱体形成部分か ら、主に非線形素子の配設位置と反対側に延びていても よい。または、非線形素子が抵抗発熱体と同一の基板上 に形成されており、基板と実質的に平行な方向に形成さ れた吐出口を有し、流路が、抵抗発熱体形成部分から、 主に非線形素子の配設位置側に延びていてもよい。いず れの場合も、大面積の非線形素子を液体吐出の邪魔にな らないように配置できる。

【0014】さらに、非線形素子に対する冷却構造を有 すると、非線形素子の発熱により非線形素子自体が破壊 してしまうことがより確実に防げる。

【0015】また、駆動状態における非線形素子の抵抗 値が、抵抗発熱体の抵抗値と実質的に等しいことが好ま しい。

【0016】また、発熱手段に電圧を印加するマトリク ス回路を構成するマトリクス電極を有していてもよい。 そして、非線形素子が、マトリクス電極の交点に位置し ていてもよい。

【OO17】また、本発明のインクジェット記録ヘッド は、熱エネルギーによりインクに膜沸騰を生起させてイ ンクを吐出するものであってもよい。

【OO18】本発明のインクジェット記録装置は、前記 抵抗発熱体に対応して設けられ、記録媒体の被記録面に 対向してインクを吐出する吐出口を有する、前記したい 40 ずれかの構成のインクジェット記録ヘッドと、記録媒体 の搬送手段とを少なくとも具備することを特徴とする。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。

【0020】 (第1の実施形態) 図1は本発明の第1の 実施形態を示す要部平面図、図2はその電気特性を示す グラフ、図3はその要部断面図、図4はその電気回路を 模式的に示す回路図である。

【0021】図1、3に示すように、本実施形態のイン

クジェット記録ヘッドは、下部層(薄膜酸化絶縁層) 2 2を有する基板 2 3 上に、絶縁性薄膜 2 4 が設けられた複数のストライプ状の下側電極(縦電極) 5 と、複数の信号電極(情報電極) 7 が形成され、さらにその上に、複数のストライプ状の上側電極(横電極) 6 が形成され、さらに薄膜抵抗発熱体(発熱素子) 2 が形成されている。このように構成された基板 2 3 に、吐出口形成部5 2 が配置されている。

【0022】基板23は、熱良導体材料に下部層22が形成されたものである。複数の下側電極5は、マトリク 10 ス回路を構成する走査電極であり、極めて薄い絶縁性薄膜24で被覆されている。これに対し、複数の上側電極6は、下側電極5と交差する方向に実質的に平行に配列され、抵抗発熱体2の一端に接続されている。また、情報電極7は、抵抗発熱体2の他の一端に接続され、マトリクス回路を構成するものである。ここで、吐出口形成部52は、各抵抗発熱体2に対応する複数の流路31が接続されている。また、各流路31は外部に向けて開口している複数の吐出口8を有している。

【0023】本実施例では、下側電極5と、上側電極6 20 と、両者の間に介在する絶縁性薄膜24とによって、M I M型電流電圧特性を示す非線形素子、すなわちM I M 素子1が構成されている。このM I M素子1の面積は抵抗発熱体2の面積より大きい。

【0024】MIM型電気特性とは、MIM素子やバリ スタの電流電圧特性のように、図2に示す通り、極性に 依らず、高電圧側では低い抵抗値を示し、低圧側では高 い抵抗値を示す電流電圧特性である。MIM素子とは、 原義的には金属/絶縁体/金属という構造のトンネル接 合素子であるが、通常は、導電体電極/絶縁体/導電体 30 電極という構造の接合素子もMIM素子と呼ぶ。ここ で、絶縁体の伝導機構としては、プールフレンケル型伝 導のような絶縁体の中で複数のトンネリングを繰り返す ホッピング型の電気伝導や、ファウラーノルドハイム型 伝導のような比較的単純なトンネル伝導などが知られて いる。こうしたトンネル型の電流が流れ、接合素子に電 流が流れるためには、電極間の距離が極めて狭い必要が ある。なお、ZnOにBiや、PrおよびCoなどの金 属酸化物を添加した焼結体層や、炭化けい素SiCの粒 状結晶層を、絶縁層の代わりに電極間に配置したいわゆ るバリスタも、前記したMIM素子と同様に非線形素子 として用いることができ、MIM型電気特性を得ること ができる。

【0025】本実施形態のインクジェット記録ヘッドは、下側電極5および情報電極7からなるマトリクス回路と、このマトリクス回路の交点に位置するMIM素子1と、MIM素子1に直列に接続された抵抗発熱体2とを有している。

【0026】このような構成であるため、後述するように、マトリクス回路を構成する下側電極5と情報電極7 50

との間に電圧を印加すると、MIM素子1がオン状態となり、抵抗発熱体2に電力が供給される。抵抗発熱体2が電力の供給を受けて発熱すると、吐出用液体供給口54から供給されて流路31内に存在する吐出用液体(インク)が急速加熱されて気泡が発生し、この発泡圧によって液滴9が吐出口8より吐出し、吐出した液滴9が外部の記録媒体(図示せず)に付着して画像が形成される。もちろん、下側電極5および情報電極7に十分な電圧が印加された個所(選択点)においてのみ、前記したとおり抵抗発熱体2の発熱および液体吐出が行われる。両電極5,7に十分な電圧が印加されていない個所(非選択点)では、液体吐出は行われない。

【0027】MIM素子1が、マトリクスをなす両電極5,7の交点に、極めて薄い下部層22を介して配置されているので、マトリクス駆動時のバイアス電圧による非吐出点(非選択点)での不要な発熱を抑制し、抵抗発熱体2をマトリクス駆動できる。また、マトリクス駆動により、図示しないドライバ(駆動手段)を抵抗発熱体2から分離して設けることが容易にできるため、高価なSi基板を用いる必要がなく、安価に大量生産することができる。

【OO28】マトリクス駆動を行うためには、ある等しい絶対値 Ioの電流を生じさせるための印加電圧 V_1 とー V_2 が、O.5 < (V_1/V_2) < 2 の関係を満足し、かつ印加電圧 $+V_1/2$ および $-V_2/2$ に対応する電流の絶対値が Io/1 の以下であることが好ましい。

【OO29】MIM素子1に電流が流れ得る、絶縁性薄 膜24の膜厚の限界値、すなわち電極5,6間の間隔の 限界値は、絶縁材料や電極材料の種類や伝導構造に大き く依存するが、MIM素子1として有為な電流が流れる ためには、電極5,6間の間隔をおおよそ100nm以 下にすることが好ましい。さらに、バブルジェット記録 ヘッドのマトリクス駆動に必要な大電流を低電圧で得る ためには、この間隔を40nm以下とすることが好まし い。一方、間隔が極端に狭いと電極5,6の金属表面の イオンが電界放射を起こすおそれがあるため、1 n m 以 上とすることが好ましい。また、安定したトンネル接合 を得るためには4nm以上とすることが好ましい。すな わち、電極5, 6間の間隔は1~100nmであること が好ましく、特に、バブルジェット記録ヘッドのマトリ クス駆動に必要な大電流を低電圧で得るためには、電極 5, 6間の間隔は4~40nmとすることが好ましい。 【0030】ただし、図1~4に示す本実施形態では、 MIM素子1とは別に抵抗発熱体2を設け、この抵抗発 熱体2により液体加熱を行っている。本実施形態では、 図1に示すように、MIM素子1の面積が、これに直列 接続された抵抗発熱体2の面積より大きいため、抵抗発 熱体2がある時間内に発泡する電力密度の電力を供給し ても、MIM素子1自体の昇温は抑制されるため、MI M素子1の破壊を防止することができる。

【0031】次に、図4を参照して、本発明のマトリクス回路について改めて説明する。図4中には、 j番目および j + 1番目の走査電極(下側電極) Yj、Yj+1と、 i番目及び i + 1番目の情報電極 Xi、Xi+1がそれぞれ模式的に示されている。走査電極 Yj、Yj+1と情報電極 Xi、Xi+1がマトリクス回路を構成しており、このマトリクス回路の交点に、非線形素子であるM I M素子 1と、抵抗発熱体 2が配置されている。また、吐出液滴9が模式的に示されている。

【0032】図4において、走査電極に選択電位波形を 10 入力し、情報電極に画像信号に応じて吐出用または非吐出用情報電位波形を入力することにより、MIM素子1をオン状態またはオフ状態に制御することができる。すなわち、選択電位波形が入力された走査電極と、吐出用情報電位波形が入力された情報電極との交点に位置するMIM素子1のみがオン状態となり、これに直列接続された抵抗発熱体2に電力が供給されて、抵抗発熱体2の一対の電極間に熱エネルギーが発生して、液滴9が吐出される。これ以外のMIM素子1は、たとえ走査電極への選択電位波形の入力または情報電極への吐出用情報電 20位波形の入力のいずれか一方のみが行われていても、オフ状態となり、これに直列接続された抵抗発熱体2には電力が供給されず、液滴9が吐出されない。

【0033】前記の通り、MIM素子1の面積が、このMIM素子1に直列接続された抵抗発熱体の一対の電極間の面積(以下、単に「抵抗発熱体の面積」とも言う)に比べて大きいほど、MIM素子1の発熱によるMIM素子1自体の破壊の危険は回避される。しかし、MIM素子1の面積が大きくなりすぎると、ヘッドの微細化が困難となるおそれがある。従来、MIM素子を液晶装置 30に用いた場合の動作時の電力密度から類推すると、MIM素子1の大きさは、直列接続された抵抗発熱体2の108倍以下とすることが好ましい。

【0034】また、ヘッドを微細化するという観点から は、MIM素子1の面積は小さいほど好ましい。しか し、バブルジェット記録ヘッドでは、特に、抵抗発熱体 2に大電力を供給するMIM素子1への印加電圧を高く して、MIM素子1がオン状態のときに吐出用液体の発 泡に必要な大電流を流すことが重要である。この要件を 満たし、かつ、素子駆動コストの上昇を避けるために駆 40 動電圧を低くするには、駆動状態におけるMIM素子1 の抵抗値 RMIM と抵抗発熱体の抵抗値 RHを実質的に等し くする必要があり、RMIM = RHであることが好ましい。 また、面積 SMIM のM I M素子 1 と面積 SHの抵抗発熱体 2とを、水を主成分とする吐出用液体中に並置すること を考えると、直列接続されたMIM素子1により沸騰を 生じさせることなく、抵抗発熱体2により膜沸騰を生じ させるためには、3. $7\,RMIM\,/SMIM\,< RH/SH$ である ことが好ましい。ここで、係数としての3.7という数 値は、水を主成分とする吐出用液体の膜沸騰温度が約3 50 ○○°であり、通常の沸騰温度が100°で程度で、室温が約25°であると想定して算出されたものである。このように、上記した2つの条件式より、SMIM > 3.7 SHであることが好ましい。すなわち、非線形素子1の面積が抵抗発熱体2の面積より3.7倍~108倍の大きさであることが好ましい。

【0035】本実施形態では、MIM素子1の、吐出口8の配列方向の長さが、MIM素子1の、吐出口8の配列方向と実質的に垂直な方向の長さよりも短いので、吐出口8とMIM素子1を高密度に並べることができる。また、本実施形態では、MIM素子1が抵抗発熱体2と同一の基板23上に作成され、基板23と実質的に垂直な方向に吐出口5が形成されており、また、流路31が、抵抗発熱体2の形成部分から、主にMIM素子1の配設位置と実質的に反対側に向かって延びているので、大面積のMIM素子1を液体吐出の邪魔にならないように配置できる。

【0036】本実施形態のMIM素子1の製造方法につ いて説明すると、このMIM素子1は、ストライプ状の 金属電極(下電極)5を陽極酸化して得られる絶縁性薄 膜(酸化絶縁膜)24の上に、下電極5と交差するスト ライプ状の金属電極(上電極) 6が配設された構成であ る。具体的には、下電極5は、RFスパッタ法で厚さ約 300nmのTa薄膜を形成した後、その表面を陽極酸 化法で酸化して厚さ約32nmのTa2O5薄膜を形成し たものである。この時、RFスパッタ工程は約10-2 T orr程度のArガス雰囲気中で行う。また、陽極酸化 工程は、0.8重量%のクエン酸水溶液中でメッシュ状 白金電極を陰極として行う。また、上電極6および情報 電極7は厚さ23nmのタンタル薄膜電極であり、基板 23は結晶軸<111>の厚さ0.625mmのSi基 板であり、下電極5の表面の下部層22は厚さ2.75 μmのSi熱酸化膜であり、抵抗発熱体2は、厚さO. O5μmの窒化タンタル薄膜である。

【0037】本実施形態では、抵抗発熱体2は、大きさ が25 μ m×25 μ mで面積が625 μ m²であり、そ の素子抵抗は53Ωである。また、流路31の幅は30 μmで、流路間の間隔は80μmである。MIM素子1 の大きさは84. 5μm×20000μmで面積は16 90000μm²であり、吐出口8の配列方向と垂直な 方向に長く延びる帯状である。また、MIM素子1の面 積は、抵抗発熱体2の面積の2704倍である。また、 MIM素子1の両端、すなわち下電極5と上電極6との 間に印加される電圧が6.7Vの場合、MIMの素子抵 抗は53Ωである。よって、下電極5と情報電極7との 間に13. 4 Vの電圧を印加すると、M I M素子 1 およ び抵抗発熱体2のそれぞれに6. 7 Vの電圧が印加さ れ、126mAの電流が流れる。この時、MIM素子1 および抵抗発熱体2で熱に変換される消費電力は0.8 47Wであり、MIM素子1の電力密度はO. 5MW/

m²、抵抗発熱体2の電力密度は1.355GW/m²である。このような条件で抵抗発熱体2に電力が供給されると、吐出用液体を加熱し発泡させる十分な発熱が生じる。また、MIM素子1の単位面積あたりの発熱量は抵抗発熱体2の単位面積あたりの発熱量の1/2704であるため、温度上昇を抑えることができる。また、特に、下部層22を介してSi基板23に熱が逃げるため、MIM素子1の温度上昇を効率よく抑制できる。さらに、MIM素子1と抵抗発熱体2の抵抗値が等しいため、抵抗発熱体2に大電力を供給するとともにMIM素 10子1の動作電圧が高く、MIM素子1がオン状態のときに吐出用液体の発泡に必要な大電流を流すことが可能である。

【0038】(第2の実施形態)図5には、本発明の第2の実施形態のインクジェット記録ヘッドの要部が示されている。第1の実施形態と同様な部分には、同一の符号を付与し説明を省略する。

【0039】本実施形態では、MIM素子1が抵抗発熱体2と同一の基板23上に形成され、基板23と実質的に平行な方向に吐出口18が形成されている。流路19 20は、抵抗発熱体2の形成部分から、主にMIM素子1の配設位置側に延びている。そのため、広い面積を有するMIM素子1が、液体吐出の邪魔になることはない。また、MIM素子1の一部分が吐出用液体に熱的に接触しているため、MIM素子1で発生する熱を吐出用液体にも逃がすことができ、MIM素子の温度上昇を効果的に防止できる。

【0040】(第3の実施形態)図6は、本発明の第3の実施形態のインクジェット記録ヘッドの要部が示されている。第1,2の実施形態と同様な部分には、同一の符号を付与し説明を省略する。

【0041】本実施形態では、全体が薄膜層を介して吐 出用液体に接しているM I M素子11が設けられてい る。MIM素子11および抵抗発熱体2上に、スパッタ 蒸着により、厚さ0. 6μ m、熱拡散率 κ =0. 47m m²/sのSiO2薄膜が積層されており、このSiO2 薄膜は、MIM素子11および抵抗発熱体2の保護膜5 05である。この保護膜505によって保護されること により、MIM素子11は、液室4および流路31の内 部に、またはそれらに隣接して配置され得る。それによ 40 って、インクジェット記録ヘッドを大型化させることな く、MIM素子11の面積を大きくすることができる。 【0042】例えば、下電極5と上電極6との間に2μ sのパルス状電圧を印加することにより液滴9を吐出さ せるとき、保護膜505に関する熱伝導距離、すなわ ち、κΔtの平方根の2倍が1.94μmである。保護 膜505の厚さが熱伝導距離よりも薄いため、吐出用電 圧が印加された時にMIM素子11により発生する熱を すみやかに吐出用液体に逃がし、MIM素子11の温度 上昇を抑制できると同時にMIM素子11を保護するこ 50

とができる。

【0043】本実施形態も、第1の実施形態と同様に、 MIM素子11の製造方法について説明すると、このM IM素子11は、ストライプ状の金属電極(下電極)5 を陽極酸化して得られる絶縁性薄膜(酸化絶縁膜)24 の上に、下電極5と交差するストライプ状の金属電極 (上電極) 6が配設された構成である。具体的には、下 電極5は、RFスパッタ法で厚さ約300nmのTa薄 膜を形成した後、その表面を陽極酸化法で酸化して厚さ 約32nmのTa2O5薄膜を形成したものである。この 時、RFスパッタ工程は約10-2Torr程度のArガ ス雰囲気中で行う。また、陽極酸化工程は、O.8重量 %のクエン酸水溶液中でメッシュ状白金電極を陰極とし て行う。また、上電極6および情報電極7は厚さ23 n mのタンタル薄膜電極であり、基板23は結晶軸<11 1>の厚さ0. 625mmのSi基板であり、下電極5 の表面の下部層22は厚さ2. フ5μmのSi熱酸化膜 であり、抵抗発熱体2は、厚さ0. 05μmの窒化タン タル薄膜である。

【0044】本実施形態では、抵抗発熱体2は、大きさ が40μm×40μmで面積が1600μm²であり、 その素子抵抗は53Ωである。また、流路31の幅は6 Oμmで、流路間の間隔は80μmである。MIM素子 11の大きさは42.25μm×40000μmで面積 は1690000μm²であり、吐出口8の配列方向と 垂直な方向に長く延びる帯状である。MIM素子11の 面積は、抵抗発熱体2の面積の1056倍である。ま た、MIM素子11の両端、すなわち下電極5と上電極 6との間に印加される電圧が 6. 7 V の場合、M I M の 素子抵抗は53Ωである。よって、下電極5と情報電極 7との間に13. 4Vの電圧を印加すると、MIM素子 11および抵抗発熱体2のそれぞれに6.7 Vの電圧が 印加され、126mAの電流が流れる。この時、MIM 素子11および抵抗発熱体2で熱に変換される消費電力 は O. 8 4 7 Wであり、M I M素子 1 1 の電力密度は 0. 5MW/m²、抵抗発熱体2の電力密度は0. 52 9 GW/m²である。このような条件で抵抗発熱体2に 電力が供給されると、吐出用液体を加熱し発泡させる十 分な発熱が生じる。また、MIM素子11の単位面積あ たりの発熱量は抵抗発熱体2の単位面積あたりの発熱量 の1/1056であるため、温度上昇を抑えることがで きる。

【0045】また、3.7RMM/SMM<RH/SHの条件が満たされているため、MIM素子11の設計時に考慮していない、水を主成分とする泡が発生し吐出が不安定になるおそれがない。

【0046】本実施形態では、MIM素子11が吐出用液体に隣接して配置されており、これが放熱構造、すなわち冷却構造として作用する。具体的には、MIM素子11が、その電極に接する熱拡散率 κの保護膜505を

有し、MIM素子11に期間 Δ tのパルス電圧が印加されるときに、保護膜505の厚さが κ Δ tの平方根の2倍以下となっている。これにより、MIM素子11の発熱によるMIM素子11自体の破壊を防止できる。

【 O O 4 7 】次に、上述した各実施形態で示したインク ジェット記録ヘッドを搭載したインクジェット記録装置 の一例の模式図を図7に示す。

【0048】このインクジェット記録装置は、駆動回路 403によりその駆動を制御される紙送りローラ405 で被記録媒体である紙406を搬送する構成となってい 10 る。また、制御部404により制御されるインクジェッ ト記録ヘッド40フは、その各吐出口が、搬送されてく る紙406に対向するように設けられており、制御部4 O 4からの信号に応じて非線形素子1をオン状態または オフ状態に制御することにより、吐出口8からの吐出液 滴9の吐出および非吐出を制御する。このようにして電 力が供給された抵抗発熱体2上のインクが急速に加熱さ れることで、抵抗発熱体2表面全域に一斉に膜沸騰現象 に基づく気泡が、きわめて高い圧力を伴って発生する。 この圧力によって、上述したように吐出液滴9が吐出口 20 8から吐出され、被記録媒体上に画像が形成される。ま た、吐出液滴9の吐出に伴い、インクタンク402から インクジェット記録ヘッド40フヘインクが供給され

[0049]

【発明の効果】本発明によると、非線形素子の面積が、これと直列接続された抵抗発熱体の、一対の電極間の面積よりも大きいため、非線形素子の発熱により非線形素子自体が破壊してしまうことが防げる。特に、非線形素子の面積が、抵抗発熱体の、一対の電極間の面積の3.7倍~10⁸倍であると、非線形素子の発熱により非線形素子自体が破壊してしまうことが防げるとともに、ヘッドの小型化の妨げとならない。さらに、吐出用液体の発泡に必要な大電流を流しつつ、素子駆動コストの上昇を生じない程度に駆動電圧を低く抑えることができる。【0050】また、非線形素子の、吐出口配列方向の長さが、該配列方向と実質的に直交する方向の長さよりも

短いと、吐出口と非線形素子を高密度に並べることができる。 【0051】さらに、非線形素子に対する冷却構造を有

すると、非線形素子の発熱により非線形素子自体が破壊

してしまうことがより確実に防げる。

【0052】これらの結果、低コストで長尺化が可能なインクジェット記録ヘッドおよびインクジェット記録装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態のインクジェット記録 ヘッドの要部平面図である。

【図2】MIM型電気特性の説明図である。

【図3】第1の実施形態のインクジェット記録ヘッドの要部断面図である。

) 【図4】第1の実施形態のインクジェット記録ヘッドを 模式的に示す電気回路図である。

【図5】本発明の第2の実施形態のインクジェット記録 ヘッドの要部平面図である。

【図6】本発明の第3の実施形態のインクジェット記録 ヘッドの要部平面図である。

【図7】本発明のインクジェット記録ヘッドを搭載した、本発明のインクジェット記録装置の一例を示す模式 図である。

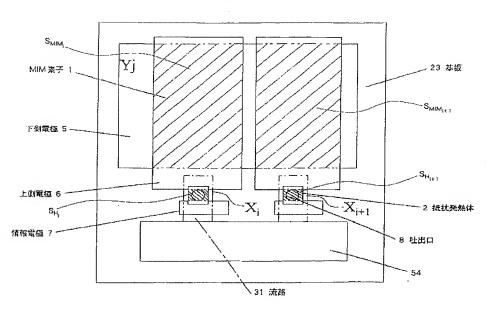
【符号の説明】

505

20	1	MIM素子(非線形素子)
	2	薄膜抵抗発熱体 (発熱素子)
	5	下側電極 (縦電極)
	6	上側電極(横電極)
	7	信号電極(情報電極)
	8	吐出口
	9	液滴
	1 1	M I M素子(非線形素子)
	1 8	吐出口
	19	流路
30	2 2	下部層 (薄膜酸化絶縁膜)
	2 3	基板
	2 4	絶縁性薄膜
	3 1	流路
	5 2	吐出口形成部
	5 4	吐出用液体供給口
	402	インクタンク
	403	駆動回路
	404	制御部
	405	紙送りローラ
40	406	紙
	407	インクジェット記録ヘッド

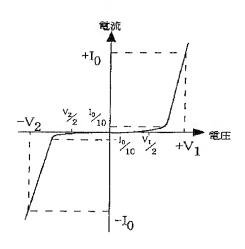
保護膜

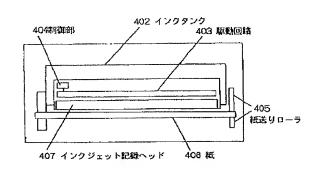
【図1】



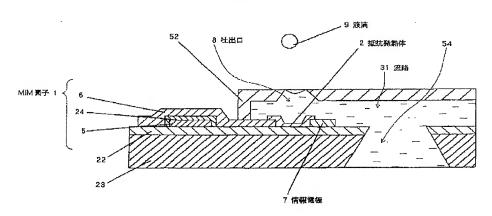


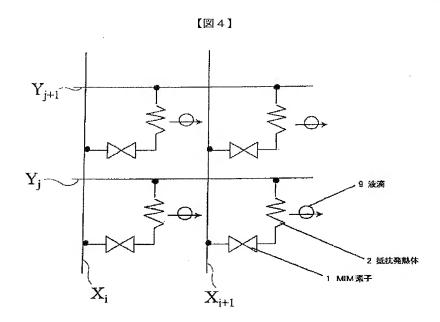
【図7】

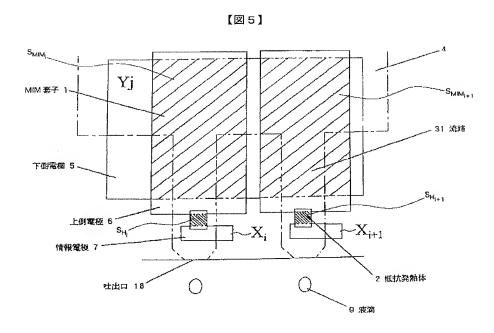




【図3】







【図6】

